

三配位硅正离子研究的新进展

谢作伟

香港中文大学化学系

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 本文综述了固相和液相中三配位硅正离子(R_3Si^+)研究的最新进展,讨论了硅上不同取代基,阴离子及溶剂对硅正离子特征的影响。

关键词 [晶体结构](#) [X射线衍射分析](#) [核磁共振](#) [有机硅化合物](#) [硅烷](#)

分类号 [0611.662](#)

Recent advances in approaching silylium ions

XIE ZUOWEI

Abstract This article reviews recent progress and the exiting problems in approaching silylium ions (R_3Si^+), one of the long sought-after cations, in the condensed media. Effects of substituents R, counterions and solvents on silylium ion character are discussed.

Key words [CRYSTAL STRUCTURE](#) [X-RAY DIFFRACTION ANALYSIS](#) [NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE](#) [ORGANO SILICON COMPOUNDS](#) [SILANE](#)

DOI:

通讯作者

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF\(0KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [复制索引](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“晶体结构” 的相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章
- [谢作伟](#)